

國立交通大學

電子工程學系 電子研究所碩士班

碩士論文

鈾金屬閘極絕緣層、鈹金屬閘極絕緣層

及複晶矽氮氧化層之研究



**The Study of Cerium-based Gate Dielectrics,
Hafnium-based Gate Dielectrics, and Interpoly
oxynitride**

研究生：江國誠

指導教授：雷添福 博士

中華民國 九十三年六月

鈾金屬閘極絕緣層、鈷金屬閘極絕緣層
及複晶矽氮氧化層之研究

**The Study of Cerium-based Gate Dielectrics,
Hafnium-based Gate Dielectrics, and Interpoly
oxynitride**

研究生：江國誠
指導教授：雷添福 博士

Student: Kuo-Cheng Chiang
Advisor: Dr. Tan-Fu Lei



A Thesis
Submitted to Institute of Electronics
College of Electrical Engineering and Computer Science
National Chiao Tung University
In Partial Fulfillment of the Requirements
For the Degree of
Master of Science
in
Electronic Engineering
June 2004
Hsinchu Taiwan Republic of China

中華民國 九十三年六月